太陽フレアの密度診断に有用な 多価イオン EUV 発光線強度比の測定

中村信行研究室 河野泰隆

1 序論

1.1 太陽大気の分光診断

1.1.1 太陽コロナ/フレア

太陽系の中心として輝き続け、長年研究対象 とされてきた太陽だが、未だにそのメカニズム に謎は多い。例として、太陽大気の最外部に存 在するコロナ領域にて発生する、数千万度の高 温に達する太陽フレアと呼ばれる巨大な爆発現 象が挙げられる。これに伴って宇宙空間に放出 された荷電粒子や宇宙線により人工衛星に搭載 された電子機器に影響を及ぼし、通信障害の原 因の一端となっているが、現在においても詳し い原因については解明されていない。

太陽における物理現象解明のため、国立天文 台と宇宙航空研究開発機構が主導の元に開発さ れた太陽観測衛星「ひので (Solar-B)」が 2006 年から現在まで運用されている。ひのでによる 観測結果は、波動加熱説の直接的な証拠となる 発見 [1] 等、現在に至るまで多くの研究成果に寄 与している。

1.1.2 衝突輻射モデルを用いたプラズマ分光 診断

多価イオンは天体プラズマにおける分光診断 に有用とされている。これは恒星といった高エ ネルギーを持つ天体において大量に生成された 多価イオンが、宇宙空間では他の原子や電子と 相互作用を受けにくいため、地上に比べ多く存在 することが出来ることにある。よって、宇宙空 間における高温プラズマを理解するためには多 価イオンに対する理解が重要となる。太陽大気 におけるプラズマ分光診断には、観測により得ら れたスペクトルの強度比の実測値と理論計算に よって得られる強度比の電子密度依存性を対応 させることで大気中の電子密度を求めるという 事例がある。例えば、太陽コロナにおける電子密 度診断において、Fe XIII をはじめとする鉄多価 イオンの発光線強度比の観測が盛んに行われて いる [2]。 この強度比の電子密度依存性は、衝突 輻射モデル (Collisional-Radiative model:CRmodel) と呼ばれるモデルを用いて理論的に算出 され、太陽観測衛星「ひので (SOLAR-B)」など により得られた強度比の実測データと対応させ ることで、太陽大気の電子密度を得ることが出 来る。

しかしながら、CR モデルには実験により十 分な評価を得ていない理論値が用いられており、 CR モデルを用いたプラズマ診断結果の信頼性 は十分ではない。実際、Fe XV における 233.9Å と 243.8Å のラインについて 1990 年に観測衛星 Skylab による太陽フレアの観測結果とモデル計 算との顕著な差異があった例が報告されている [3]。

1.2 研究目的

本研究では、太陽フレアの密度診断に利用さ れる 3.2×10^{6} K の温度領域において重要な Ar XIV の波長 187.96Å と 194.40Å のスペクトル 強度比 $R_1 = I_{187.96}/I_{194.40}$ および波長 257.37Å と 243.79Å の強度比 $R_2 = I_{257.37}/I_{243.79}$ の電 子密度依存性と、より高温域で重要となる Ca XV の波長 181.90Å と 200.97Å の強度比 $R_1 =$ $I_{181.90}/I_{200.97}$ の電子密度依存性を、多価イオ ン源の一種である電子ビームイオントラップ (Electron Beam Ion Trap: EBIT) を用いた観 測により求め、実験値を CR モデルを用いて計 算した強度比の電子密度依存性と比較すること により CR モデルの評価を行った。

2 実験

2.1 電子ビームイオントラップ (Electron Beam Ion Trap:EBIT)

2.1.1 原理

本研究で使用したイオン源は電子ビームイオ ントラップ (通称:EBIT) と呼ばれるものである。 基本的に電子銃、ドリフトチューブ (Drift Tube:DT)、コレクタ、超伝導コイルから構成 され、側面が穴の開いた構造となっている多価 イオン生成領域の周囲に各種分光器が配置され る。イオン生成には逐次電離と呼ばる、ある一 定のエネルギーを持つ電子を衝突させ続けるこ とで、目的の価数まで1つずつ束縛電子を電離 させる方法を用いている。

また、EBIT の電子ビームは一定のエネルギー を持つことから理想的には単色であるため、核 融合科学研究所に設置されている大型ヘリカル 装置 (Large Helical Device:LHD) などの核融合 プラズマと比べ、多価イオン生成時の価数分布 が狭いという特徴を持つ。これにより、比較的 単純なスペクトルとなり、波長の同定や強度比 の取得等が行いやすいという利点がある。

本研究では「Compact EBIT」および「Tokyo-EBIT」という2種類のEBITを用いた。Compact EBIT は通称 CoBIT とも呼ばれ、最大ビー ムエネルギーは 2.5keV、最大ビーム電流値は 20mA であり、中心磁場は最大で 0.2T となる。 CoBIT において、Ar XIV スペクトルの測定で 実際に使用した分光器等の配置図を図 2.1 に示 す。 CoBIT 内部において多価イオンによる発



図 2.1 CoBIT における分光器等の配置図 (Ar XIV スペク トル取得時)。Ca XV スペクトル取得時には「ピンホールカ メラ」に当たる部分に Ca 導入用の蒸着セル (K-Cell) が取 り付けられている (後述)。

光は細い線状となる上、極端紫外領域では高効 率のミラーやレンズが使用できないため極端紫 外分光器はスリットを用いない構造となってい る [4]。対して、Tokyo-EBIT は最大エネルギー 180keV、最大電流 330mA の電子ビームの発生 が可能で、トラップ領域において最大 4.5T の強 磁場を発生させることが出来る。Tokyo-EBIT においても、CoBIT と同様 (図 2.1) に分光器等 を配置し観測を行っている。

2.2 極端紫外スペクトルの測定

本研究で取得したスペクトルは EBIT に設置 されている EUV 分光器を用いて観測を行った。 得られたスペクトルは目的となるライン及びそ の周辺についてガウシアンフィッティングを行 い、強度比及び後述する電子密度依存性測定の ためのスペクトル半値全幅の決定を行った。

使用した EUV 分光器について、基本的には Tokyo-EBIT 及び CoBIT の 2 台ともに同じ光 学配置の分光器が設置されている。回折格子 には日立ハイテク社製の平面結像型凹面不等 間隔回折格子を使用している。また、受光器と なる CCD カメラには Princeton Instruments 社の背面照射型 CCD(Charge Coupled Device) カメラ (PIXIS-OX:400B)を使用している。こ の装置の感光面の大きさはピクセルにおいて 400×1340pixel であり、ピクセルサイズは 20 μ m となっている。Tokyo-EBIT で取得時間 120 分 として得られた Ar XIV と Ca XV の EUV ス ペクトルの内、ビーム電流 15mA で測定したも のを図 2.2.2.3 に示す。



図 2.2 Tokyo-EBIT においてビーム電流を 15mA として 取得した Ar XIV の EUV スペクトル



図 2.3 Tokyo-EBIT においてビーム電流を 15mA として 取得した Ca XV スペクトル

2.3 電子密度の測定

本研究では、EUV スペクトルの観測による強 度比の測定とともに EBIT 内における電子密度 を実測する必要がある。ただし、イオンは一般 に電子ビームより広い空間分布を持つことが知 られている [5]。よって、イオンの感じる実効的 な電子密度を導出するにはイオンの広がり (イオ ン雲) によるオーバーラップを考慮する必要が ある。

本研究の場合、例として Ar XIV では、EUV 領域における発光は電気双極子遷移 (E1) 遷移に よるものであり寿命は 10^{-10} s 程度であるのに比 べ、波長 441nm の遷移は磁気双極子 (M1) 遷移 であり、その寿命は 9.6ms にも及ぶ [6] ことか ら、電子ビーム外で発光するイオンの存在が考 えられる。 これを考慮してより厳密な電子密度 を表す実効電子密度 n_e^{eff} が取り入れられている [7]。実効電子密度を表す式を式 (2.1)[7] として 示す。

$$n_e^{\text{eff}} = \frac{4\ln(2)}{\pi(\Gamma_e^2 + \Gamma_i^2)} \cdot \frac{I_e}{ev_e}$$
(2.1)

ここで、 Γ_e は電子ビームの空間分布、 Γ_i はイオ ン雲の空間分布を表す。より厳密に実効電子密 度 $n^{\text{eff.e}}$ を測定するためには、電子ビーム径 Γ_e 及 びイオン雲の径 Γ_i のそれぞれを直接測定する必 要がある。よって、本研究では EUV 領域と可視 光領域において同時観測を行うことで、電子ビー ム径とイオン雲の径を求めた。電子ビーム径の 測定には、EUV 領域におけるスペクトル幅やピ ンホールカメラの原理を用いたイメージングに より得られた像を用いた。これら得られた像に ガウシアンフィッティングを行った後、受光器 のピクセルサイズを用いて線幅に変換すること で電子ビーム径が求められる。EUV 分光器およ びピンホールカメラの倍率は、それぞれ 0.25 倍 および 12.1 倍であった。ただし、Tokyo-EBIT では EUV 領域におけるイメージがビーム径を 反映していない可能性が考えられており、更に ピンホールカメラによる直接観測が難しいこと から、EBIT における電子ビームの径を表す経験 式を用いている。この経験式は CoBIT におけ る議論についても用いている。また、磁気双極 子遷移のスペクトルが観測される可視領域には、 Tokyo-EBIT、CoBIT 共にツェルニ・ターナー 型分光器を使用し、回折格子には反射型平面回折 格子 (300gr/mm) を、受光器である CCD カメ ラには Tokyo-EBIT に Princeton Instruments 社の背面照射型 CCD カメラ (PIXIS-OX:400B) が、CoBIT には Andor 社製の背面照射型 CCD カメラ (iDus 416) が使用している。本研究で は、イオン雲の径を導出することが目的となる ため入射スリットは全開となる 2mm としてお り、Tokyo-EBIT 及び CoBIT における倍率はそ れぞれ 0.85 倍とほぼ等倍であった。

3 結果と考察

3.1 EUV スペクトル及び強度比

Ar XIV の実験において、Tokyo-EBIT 及び CoBIT の電子ビームエネルギーはどちらも 750eV に、電子ビーム電流は Tokyo-EBIT で は 5.7 と 15mA に、CoBIT では 15mA に設定 した。このとき、Tokyo-EBIT および CoBIT の の中心磁場はそれぞれ 1T と 0.05T であった。

Ca XV イオンの生成は、図 2.1 においてピ ンホールカメラとなっている部分を蒸着セル (K-Cell) に換装した後、セル内部で金属カル シウムを加熱することで気化させ導入するこ とで行った。このとき、K-Cell での加熱温度 は Tokyo-EBIT で 600 ℃、CoBIT で 450 ℃で あった。Ca XV の測定において、Tokyo-EBIT 及び CoBIT の電子ビームエネルギーはどちら も 890eV、電子ビーム電流は Tokyo-EBIT では 15mA に、CoBIT では 14mA に設定し、スペ クトルの取得時間は 120 分とした。このとき、 Tokyo-EBIT および CoBIT のの中心磁場はそ れぞれ 1T と 0.056T であった。

強度比のエラーは、フィッティングエラーと CCD における感度補正や回折格子の回折効率 を考慮したものを表示している。CCD で取得 されるカウント数は受光面に到達した光子のエ ネルギーに依存する。Ar XIV を例とすると、 187.96Å の強度は 194.40Å の強度より 3% 程強 く取得されると考えられる。また、CCD カメラ の量子効率により 187.96Å の強度が 1% 増加す ると決定した。加えて、使用した回折格子にお ける波長ごとの相対効率を示したデータ [8] を用 いて、3% 程 187.96Å の強度が増加すると決定 した。以上より 187.96Å の強度は 194.40Å の強 度より 8% 増強されていることを考慮して補正 を行った。

3.2 実効電子密度決定

(I) 電子ビームの空間分布決定

電子ビームの空間分布 Γ_e は、EUV スペクト ルの線幅、ピンホールカメラによる直接観測、 および経験式よりそれぞれ導出した。ただし、 Tokyo-EBIT では経験式のみを用いている。 (i)EUV スペクトル幅による導出

CoBIT の DT2 における電極の間隔は電子 ビームの幅に比べて十分に広く、EUV 分光器 はスリットを用いない構造となっているため、 EUV スペクトルの線幅は全て電子ビーム径を反 映しているものと考えられる。よって、スペク トルの線幅は全て同様として考えフィッティン グを行っている。

(ii) ピンホールカメラによる導出

CoBIT においては、ピンホールカメラによる 電子ビームの直接観測を行っている。ただし、 Ca XV の測定では試料導入のためにカメラを取 り外したため、測定を行っていない。例として Ar XIV で取得した電子ビームイメージの例を 図 3.1 に示す。

(iii) 経験式による導出

電子ビームエネルギーやビーム電流、トラッ プ領域における中心磁場、電子銃の陰極表面に



図 3.1 ピンホールカメラによって得られた電子ビームイメージの例。青点が測定点、赤点がフィッティング結果を表している。

おける電子温度、陰極の半径といったパラメー タが分かれば、EBIT 内の電子ビーム半径は経 験式 [9] により求めることが出来る。この経験式 を使用した電子ビーム径の導出方法は、直接観 測との比較のため CoBIT においても用いた。

(II) イオン雲の空間分布決定

イオン雲の空間分布は、可視光領域における 441nm(Ar XIV)、569nm(Ca XV)の発光の像を 求めることにより得た。Ar XIVの測定において 得られた像とフィッティング結果を図 3.2 に示 す。CoBIT で取得したラインについてはフィッ ティングを問題なく行えたが、Tokyo - EBIT で取得したラインは単純なガウシアンフィッ ティングは行うことが出来なかった。しかし、 EBIT-Iを使用して行われた Fe XII-XIVを対象 とした実験 [10] においてイオン雲の測定の際に 同じようなラインが観測されており、ここでは 半値全幅の違う二つのガウス分布の重なりとし て扱われていた。よって、本研究においてもこ の方法を適用してフィッティングを行っている。

各電子密度について、最大値と最小値をそれ ぞれ求めた。Tokyo-EBIT における最大値は電 子ビームの空間分布 Γ_e と狭いイオン雲の空間分 布 Γ_{i1} を用いて式 (2.4) により求めた値、最小値 は電子ビームの空間分布を Γ_{i1} とし二重のガウ ス分布を考慮した場合に実効電子密度を表す式 [10] を用いた値とした。また、CoBIT における 最大値および最小値は、電子ビーム径の測定に



図 3.2 Tokyo-EBIT(上中図) 及び CoBIT(下図) における 441nm のライン観測結果とフィッティング結果。スリッ トは全開 (2mm) として取得し、横軸は CCD のカタロ グ値より Tokyo-EBIT では 1pixel= 24μ m、CoBIT では 1pixel= 15μ m として計算した。青点がスペクトル測定点、 赤線がフィッティング結果。また、Tokyo-EBIT の観測結 果における黒破線はそれぞれ狭い分布と広い分布に対して 行ったフィッティング結果を示している。

用いた最大3種類の方法よりそれぞれ求めた値 により決定した。

以上により得られた Ar XIV の強度比 *R* と実 効電子密度 *n*_{eff} を表 3.1 に、Ca XV における強 度比 *R* および実効電子密度 *n*_{eff} を表 3.2 に示す。

3.3 CR モデルの評価結果および考察

以上の結果を元に、Ar XIV および Ca XV のそれぞれについて実験的に求めた強度比の電 子密度依存性を用いて CR モデル計算値を評 価した。Ar XIV についての結果を図 3.3 に、 Ca XV についての結果を図 3.4 に示す。また、 CR モデルの計算にはどちらも Flexible Atomic Code(FAC) と呼ばれる原子計算コードを用いて おり、単色光として計算を行った。太陽大気に おけるプラズマの発光は EBIT 内部のような単 色光ではなく広い波長領域を持つため、電子の エネルギー分布がマクスウェル分布に従う場合 の Ar XIV の強度比 *R*₁ を 3,6,9MK の電子温度 について CR モデルより計算した結果も図 3.3 中に示している。この結果、高密度領域におい ては電子温度による強度比の変化が見られたが、 全て同様の電子密度依存性を示していた。



図 3.3 Ar XIV における強度比の電子密度依存性と CR モ デルの評価結果。上図が $R_1 = I_{187.96}/I_{194.40}$ における評 価結果、下図が $R_2 = I_{257.37}/I_{243.79}$ における評価結果を示 している。赤線が Tokyo-EBIT における強度比の電子密度 依存性であり、高密度側がビーム電流を 15mA、低密度側が 5.7mA とした場合の実験結果である。また、青線が CoBIT における強度比の電子密度依存性であり、黒実線が CR モデ ルを用いて Ar XIV の強度比の電子密度依存性を計算した 結果である。また、 R_1 については図中に電子密度分布がマ クスウェル分布に従い、電子温度が 3,6,9MK のそれぞれに おける CR モデルの計算結果を緑線で示している。

今回の評価において、Tokyo-EBIT における 電子ビームの空間分布測定に経験式のみを用 いていることや、CoBIT において電子ビーム の径の見積もりに差があるといった課題は残っ ているが、Ar XIV と CaXV の両方において Tokyo-EBIT と CoBIT のどちらにおける実験 値も理論値に対して良い一致を示したといえる。 このことから、太陽フレアの観測で必要とされ る 3.0×10⁶K 以上の温度領域について Ar XIV および Ca XV のラインに対して CR モデルを 用いた電子密度診断が有用であると言える。

表 3.1 Ar XIV の実験により得られた強度比および実効電子密度の一覧

装置	R_1	$\log_{10} n_{\mathrm{eff}}$	R_2	$\log_{10}n_{ m eff}^{'}$
Tokyo-EBIT $(15mA)$	1.35 ± 0.07	10.9 - 11.3	$0.72 {\pm} 0.06$	10.9 - 11.3
Tokyo-EBIT (5.7mA)	1.09 ± 0.09	10.6 - 11.0	0.49 ± 0.08	10.6 - 11.0
CoBIT(15mA)	0.58 ± 0.04	9.89 - 9.97	0.20 ± 0.02	9.78 - 10.4

表 3.2 Ca XV の実験により得られた強度比および実効電子密度の一覧

装置	R	$\log_{10} n_{\rm eff}$
Tokyo-EBIT(15mA)	1.30 ± 0.20	11.64 - 11.81
CoBIT(14mA)	0.31 ± 0.14	10.08 - 10.11



図 3.4 Ca XV における強度比の電子密度依存性と CR モ デルの評価結果。赤線が Tokyo-EBIT における強度比の電 子密度依存性であり、青線が CoBIT における強度比の電子 密度依存性である。黒実線は CR モデルを用いて Ar XIV の強度比の電子密度依存性を計算した結果である。

4 結論

本研究では、EBITと呼ばれる多価イオン観測 装置を用いて、天体プラズマの電子密度診断に 用いられる衝突輻射モデルの評価を行った。評 価を行うため、Tokyo-EBITとCoBITと呼ば れる2台の装置を用いて、電子密度に敏感であ る準安定状態への遷移を含むArXIVのスペク トルおよびCaXVのスペクトルを取得し、基 底状態への遷移に対する準安定状態への遷移に おける強度比を求めた。それと同時に多価イオ ンのトラップ領域における実効電子密度を求め ることで、強度比の電子密度依存性を実験的に 取得することで、Flexble Atomic Codeと呼ば れる原子コードを用いて衝突輻射モデルにより 計算された電子密度依存性の理論値を比較し評 価を行った。この結果、Ar XIV と Ca XV のど ちらにおいても Tokyo-EBIT および CoBIT に おける実験値と理論値は良い一致を示しており、 3.0×10⁶K 以上の温度領域について Ar XIV お よび Ca XV のラインに対して CR モデルも用 いた天体プラズマの電子密度診断が有用である ことが結論付けられた。

参考文献

- Takenori J. Okamoto et al. (2015) ApJ 809 71
- [2] P.R. Young et al. (2008) A&A 495 600
- [3] P. L. Dufton et al. (1990) ApJ 353 323-328
- [4] N. Nakamura (2013) PFR 8 1101152-2
- [5] J. D. Gillaspy et al. (1995) Physica Scripta. T59 392-395
- [6] A. Lapierre et al. (2006) PRA 73 052507
- [7] E. Shimizu et al. (2017) A&A 601 A111
- [8] B. Tu et al. (2017) AIP Adv. 7 045219
- [9] M. A. Levine et al. (1988) Physica Scripta. T22 157-163
- [10] T. Arthanayaka et al. (2020) ApJ. 890 77